

No.	시험항목	이용장비명	단위	수수료(원)	예약허용	사이트노출
350	입회시험	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	200,000	허용	노출
349	분쇄/분급 공정	고효율 미세 분급/분산 장비	시료	171,000	허용	노출
348	기본사용	마이크로 라만분광기	시료	40,000	허용	노출
347	기본 사용	초고온 진공소성로	시간	170,000	허용	노출
346	기본 사용	진공탈지로	시간	50,000	허용	노출
345	스크린프린팅	스크린프린터	시료	52,000	허용	노출
344	시간추가(2시간)	다공성 나노입자 기공률 측정기	시간	32,000	허용	노출
343	기본사용(색차/투과)	색차 및 광투과율 측정기	시료	40,000	허용	노출
342	기본사용	다공성 나노입자 기공률 측정기	시료	80,000	허용	노출
341	기본 사용	2축 필름압출시스템	시간	50,000	허용	노출
340	기본사용	이중압출복합재 제조장비	시간	80,000	허용	노출
339	시간추가	초고온 건조기	시간	20,000	허용	노출
338	기본사용(2시간)	초고온 건조기	시간	50,000	허용	노출
337	기본사용	메탈라이징로	시간	100,000	허용	노출
336	기본사용	열분석기-적외선분광기	시료	50,000	허용	노출
335	정성 및 정량 분석	고분해능 X선 형광분석시스템	시료	50,000	허용	노출
334	기본사용4(26.5GHz~40GHz)	초고주파대역 전자파차폐 측정기	시료	50,000	허용	노출
333	기본사용3(18GHz~26.5GHz)	초고주파대역 전자파차폐 측정기	시료	50,000	허용	노출
332	기본사용2(0.1MHz~3GHz)	초고주파대역 전자파차폐 측정기	시료	50,000	허용	노출
331	기본사용1(500MHz~18GHz)	초고주파대역 전자파차폐 측정기	시료	50,000	허용	노출
330	KOLAS 성적서(투과율/반사율)	자외선/가시광선/근적외선 분광기	시료	120,000	허용	노출
329	기본사용(흡광도,투과율,반사율)	자외선/가시광선/근적외선 분광기	시료	25,000	허용	노출
328	기본사용	시트 커팅 적층 머신	시료	150,000	허용	노출
327	기본사용	오토편칭머신	시료	150,000	허용	노출
326	입회시험(기본)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	250,000	허용	노출
325	입회시험(태양전지)	Dr.NPAC Program(입회시험)	시료	50,000	허용	노출
324	분석	고정밀 분산도 측정 분석기	시간	20,000	허용	노출
323	입회시험(가속노화 및 수명시험)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	1,000,000	허용	노출
322	기본사용	고분자 저온복합시험기	시간	20,000	허용	노출
321	건식 분쇄/분급	그라인딩 건식 분쇄/분급 나노 분말 제조 장비	시간	240,000	허용	노출
320	소결 시험 및 시제품 제작	초정밀 나노입자 소결시스템	시간	100,000	허용	노출
319	금속박막	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	280,000	허용	노출
318	기본사용(선형,균일도,직각도 등)	레이저 평탄도 측정기	시료	74,000	허용	노출
317	분쇄/분급	바스켓 밀	시간	160,000	허용	노출
316	분쇄/분급	비드밀	시간	260,000	허용	노출
315	습식 분쇄/분급/분산	습식 분쇄/분급 나노 분말 제조 장비	시간	260,000	허용	노출
314	기본사용	IRHD 경도계	시료	20,000	허용	노출
313	입도분석(MS3000)	자동 습/건식 입도분석기	시료	50,000	허용	노출
312	제타 측정	자동 습/건식 입도분석기	시료	50,000	허용	노출
311	나노입도분석	자동 습/건식 입도분석기	시료	50,000	허용	노출
310	FIB - for TEM	삼중집속이온빔시스템	시료	500,000	허용	노출
309	기본측정	입자강도측정기	시료	51,000	허용	노출
308	Tapping/Contact Mode	주사탐침현미경	포인트	65,000	허용	노출
307	사이클링시험	응력완화시험기	시간	4,500	허용	노출
306	저온시험	응력완화시험기	시간	4,000	허용	노출
305	고온시험	응력완화시험기	시간	4,000	허용	노출
304	기본사용(2시간)	동적기계특성분석기	시간	50,000	허용	노출
303	기본사용	20kw RF 플라즈마 나노분말 제조 장비	Day	800,000	허용	노출
302	입회시험(치수)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	500,000	허용	노출
301	KOLAS 성적서(내환경시험)	내환경신뢰성장비	Day	220,000	허용	노출
300	KOLAS 성적서(열충격시험)	HCI 디바이스 소자 고온열충격 시험장비	Day	300,000	허용	노출

299	입회시험(광학)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	270,000	허용	노출
298	대면적 파티클 검사	이중분석주사전자현미경	회	460,000	허용	노출
297	마이크로 XRF	나노분석주사전자현미경	포인트	30,000	허용	노출
296	Mounting & Grinding & polishing	삼중집속이온빔시스템	시료	84,000	허용	노출
295	이온밀링(3시간초과)	삼중집속이온빔시스템	시료	280,000	허용	노출
294	FIB - for SEM	삼중집속이온빔시스템	시료	200,000	허용	노출
293	EDS분석 - Map	삼중집속이온빔시스템	포인트	25,000	허용	노출
292	EDS분석 - Point	삼중집속이온빔시스템	포인트	15,000	허용	노출
291	Coating system(Os,Pt,C)	삼중집속이온빔시스템	회	32,000	허용	노출
290	관찰(기본)	삼중집속이온빔시스템	시간	75,000	허용	노출
289	Mounting & Grinding & polishing	고배율 현미경	시료	84,000	허용	노출
288	유전율측정	유전율측정기	시료	18,000	허용	노출
287	입회시험(1kW)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	200,000	허용	노출
286	형상분석(촬영)	HCI 디바이스용 유연기판 신뢰성 평가장비	시료	40,000	허용	노출
285	플리커 측정	첨단 디스플레이 사용성평가 시스템	시료	50,000	허용	노출
284	기본사용(균일도, 색상, 밝기)	첨단 디스플레이 사용성평가 시스템	시간	50,000	허용	노출
283	MicroLED 기본사용	발광소재 특성평가 시스템	시료	100,000	허용	노출
282	OLED 기본사용	발광소재 특성평가 시스템	시료	50,000	허용	노출
281	기본사용	HCI 디바이스용 유연기판 신뢰성 평가장비	Day	100,000	허용	노출
280	3DP	3D프린팅시스템	시료	140,000	허용	노출
279	KOLAS 성적서(열확산계수)	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	180,000	허용	노출
278	일반항온항습기 - 온도/습도시험	HCI 디바이스 소자 조정밀 환경신뢰성 시험장비	Day	200,000	허용	노출
277	급속항온항습기 - 온도/습도시험	HCI 디바이스 소자 조정밀 환경신뢰성 시험장비	Day	200,000	허용	노출
276	기본사용(-40°C~130°C)	HCI 디바이스 소자 고온열충격 시험장비	Day	240,000	허용	노출
275	밀도측정	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	10,000	허용	노출
274	금속코팅	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	42,000	허용	노출
273	특수시료	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	80,000	허용	노출
272	비열측정	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	25,000	허용	노출
271	온도추가	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	포인트	10,000	허용	노출
270	기본사용(상온)	HCI 디바이스용 부품/소재 열전도 특성 평가시스템	시료	50,000	허용	노출
269	관찰(기본)	HCI 부품소재 발열측정 공초점 열반사현미경	시간	70,000	허용	노출
268	과부하사용1(-40°C 이하 및 130~250°C)	HCI 디바이스 소자 고온열충격 시험장비	Day	260,000	허용	노출
267	과부하사용2(250°C~300°C)	HCI 디바이스 소자 고온열충격 시험장비	Day	280,000	허용	노출
266	SLA	3D프린팅시스템	시료	140,000	허용	노출
265	후가공 (세척, 경화, 본딩)	3D프린팅시스템	시료	15,000	허용	노출
264	Inspection	3D프린팅시스템	시료	40,000	허용	노출
263	투과율	광특성프로파일러	시료	24,000	허용	노출
262	Coating system(Os,Pt,C)[CFE]	전계방출형주사전자현미경	회	32,000	허용	노출
261	EDS분석 - Point	전계방출형주사전자현미경	포인트	15,000	허용	노출
260	EDS분석 - Map	전계방출형주사전자현미경	포인트	25,000	허용	노출
259	FIB - for SEM(CFE)	전계방출형주사전자현미경	회	248,000	허용	노출
258	이온밀링(3시간초과)	전계방출형주사전자현미경	회	280,000	허용	노출
257	Mounting & Grinding & polishing	전계방출형주사전자현미경	시료	84,000	허용	노출

256	관찰(기본)	전계방출형주사전자현미경	시간	75,000	허용	노출
255	열처리	가스분위기 열처리로	Day	150,000	허용	노출
254	웨이퍼 세정	웨이퍼세정장비	시간	10,000	허용	노출
253	전기방사(기본사용)	전기방사기	시간	30,000	허용	노출
252	마이크로캡슐 제조	나노입자구형화,캡슐제조장비	시간	70,000	허용	노출
250	Paste mixer	고점도믹싱시스템	시간	30,000	허용	노출
249	3분밀(3 Roll mill)	고점도믹싱시스템	시간	50,000	허용	노출
248	Planetary Mixer(Despa mixer)	고점도믹싱시스템	시간	50,000	허용	노출
247	핫프레스(필름제조, 200도 이하)	이중 스크류 익스트루더	회	15,000	허용	노출
246	클리닝(카본)	이중 스크류 익스트루더	회	84,000	허용	노출
245	니더	이중 스크류 익스트루더	시간	20,000	허용	노출
244	Bromination 필름제작	이중 스크류 익스트루더	시간	25,000	허용	노출
243	필름제작기사용	이중 스크류 익스트루더	시간	40,000	허용	노출
242	용융방사(기본사용)	용융방사기	Day	750,000	허용	노출
241	클리닝(카본)	용융방사기	Day	380,000	허용	노출
240	이온빔처리	이온빔 작동 장비	Day	150,000	허용	노출
239	Nir 영역 측정	절대양자효율측정장비	시료	76,000	허용	노출
238	Scan mode	절대양자효율측정장비	시료	76,000	허용	노출
237	기본+펠렛제작	절대양자효율측정장비	시료	49,000	허용	노출
236	기본+액체시료	절대양자효율측정장비	시료	49,000	허용	노출
235	기본사용(단파장)	절대양자효율측정장비	시료	44,000	허용	노출
234	입자분산안정성측정	입자 분산 안정성 측정 장비	시간	30,000	허용	노출
233	기본사용(19mm익스트루더사용)	이중 스크류 익스트루더	시간	70,000	허용	노출
229	기본사용(11mm익스트루더사용)	이중 스크류 익스트루더	시간	80,000	허용	노출
228	스캐닝	3D프린팅시스템	시간	140,000	허용	노출
227	WHCK (Log)	스마트 센서 검사 시스템	회	280,000	허용	노출
226	안전규격시험	태양전지 안전규격시험장치	시료	12,000	허용	노출
225	전력분석시험	태양전지 전력분석장치	시료	12,000	허용	노출
224	전기특성시험	부품소재전기특성평가장비	시료	28,000	허용	노출
223	동작성능분포측정	동작성능분포측정시스템	시료	140,000	허용	노출
222	광원스펙트럼측정	광원스펙트로메터	시간	15,000	허용	노출
221	옥외 EL 시험	Portable옥외비접촉검사장비	시간	30,000	허용	노출
220	광(UV)조사시험	광노화시험장비	Day	1,300,000	허용	노출
219	복합환경(열충격/결로)시험	태양광 부품소재복합환경내구성시험장치	Day	220,000	허용	노출
218	모듈전류전압측정	태양광 모듈전류전압측정기	회	14,000	허용	노출
217	PID시험 + 발전성능분석	태양전지PID가속시험장비	회	1,400,000	허용	노출
216	PID시험 + 열화원인분석	태양전지PID가속시험장비	회	1,800,000	허용	노출
215	표면장력측정	표면장력측정기	시료	20,000	허용	노출
214	열화상카메라 이미지촬영	열화상카메라	시료	15,000	허용	노출
213	KOLAS 성적서(수증기투과율의 측정)	고차단투습도측정기 2 (Model 3)	Day	270,000	허용	노출
212	KOLAS 성적서(온도/습도시험)	HCI 디바이스 소자 초정밀 환경진뢰성 시험장비	Day	250,000	허용	노출
211	기본사용	디지털 터치 레오미터	시료	15,000	허용	노출
210	두께측정	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	200,000	허용	노출
209	표면개질	플라즈마 분말표면개질장비	시료	50,000	허용	노출
208	패널설계시뮬레이터	패널설계시뮬레이터	Day	180,000	허용	노출
207	열처리	분위기 열처리시스템	Day	150,000	허용	노출
206	레이저 패터닝	레이저패터닝시스템	시간	100,000	허용	노출
205	Twisting	플렉서블 내구 시험기 2	Day	70,000	허용	노출
204	열전도도	열전도도 측정기	시료	20,000	허용	노출
203	출장 및 대여	열화상카메라	Day	120,000	허용	노출
202	EL/Thermal/Raman시험	비파괴라만분석장비	시료	140,000	허용	노출
201	기본사용 + 시료제단 및 전극부착 전처리(2mm이하)	홀효과측정시스템	시료	20,000	허용	노출
200	온도계수시험	썬 시뮬레이터	시료	800,000	허용	노출
199	Hot Spot 시험	썬 시뮬레이터	시료	1,800,000	허용	노출
198	Light Soaking 시험	썬 시뮬레이터	시료	2,500,000	허용	노출

197	통합시스템 사용(재료비포함)-3day	염료감응형 태양전지제조시스템	Day	550,000	허용	노출
196	스핀코터 사용	염료감응형 태양전지제조시스템	시료	10,000	허용	노출
195	샌드블라스트 사용	염료감응형 태양전지제조시스템	시간	20,000	허용	노출
194	스크린프린팅기 사용	염료감응형 태양전지제조시스템	시간	33,000	허용	노출
193	기본사용	투과형 탁도측정기	시료	22,000	허용	노출
192	KOLAS 성적서(HAZE)	투과형 탁도측정기	시료	120,000	허용	노출
191	색차/광투과율 측정	색차 및 광투과율 측정기	시료	20,000	허용	노출
190	임대사용(소모품 및 기타 투입품 사용자 부담)	플라즈마 분말제조장비	Day	1,800,000	허용	노출
189	발전능시험	썬 시뮬레이터	시료	700,000	허용	노출
188	Ultrar apex mill(Beads mill)	습식분말제조장비	시간	70,000	허용	노출
187	기본사용	홀효과측정시스템	시료	15,000	허용	노출
186	접촉각 및 표면에너지 측정	접촉각측정시스템	시료	20,000	허용	노출
185	XRF측정	마이크로 XRF	시료	15,000	허용	노출
184	태양전지 효율 실증 모니터링	태양전지 대면적 실증장비	Day	100,000	허용	노출
183	입회시험(경도)	Dr.NPAC Program(입회시험)	회	250,000	허용	노출
180	조분쇄기(Jaw Crusher) 사용	건식분말제조장비	시간	40,000	허용	노출
179	Jet mill 분쇄/분급	건식분말제조장비	시간	80,000	허용	노출
178	Ball mill	습식분말제조장비	시간	30,000	허용	노출
177	볼밀테이블(Ball Mill Table) 사용	습식분말제조장비	시간	30,000	허용	노출
176	입자복합화	나노소재복합화장비	시간	50,000	허용	노출
175	볼밀테이블(Ball Mill Table) 사용	습식초미세분쇄기	시간	30,000	허용	노출
174	포팅	스마트 센서 검사 시스템	개	0	허용	노출
173	DFR라미네이터	라미네이터 시스템	Day	400,000	허용	노출
172	광학현미경	3D 패턴검사기	시간	20,000	허용	노출
171	패턴검사(선형성등)	3D 패턴검사기	시간	60,000	허용	노출
169	패턴노광	고정세패턴공정시스템	시간	100,000	허용	노출
168	롤투롤습식층착	롤투롤습식코팅시스템	Day	720,000	허용	노출
167	복합건조기	복합건조기	시료	180,000	허용	노출
166	오븐	복합건조기	시료	50,000	허용	노출
165	cell라미네이터 & glass+film 겸용 라미네이터	라미네이터 시스템	Day	250,000	허용	노출
164	광소결기	라미네이터 시스템	Day	30,000	허용	노출
163	박리	고정세패턴공정시스템(2)	Day	432,000	허용	노출
162	Interface Board (SNR 측정용)	스마트 센서 검사 시스템	회	0	허용	노출
161	SNR 측정	스마트 센서 검사 시스템	회	280,000	허용	노출
160	레이저가공시스템	시트가공시스템	Day	150,000	허용	노출
159	오토클레이브	시트가공시스템	Day	85,000	허용	노출
158	필름커팅기	시트가공시스템	Day	120,000	허용	노출
157	현상	고정세패턴공정시스템(2)	Day	430,000	허용	노출
156	기본이용료	고정세패턴공정시스템(2)	Day	50,000	허용	노출
155	에칭	고정세패턴공정시스템(2)	Day	720,000	허용	노출
154	분당	분당시스템	시료	12,000	허용	노출
153	라미네이트	멀티라미네이팅시스템	시료	12,000	허용	노출
152	패턴검사시스템	패턴검사시스템	시료	12,000	허용	노출
151	정전기측정기	복합내구성시험기	시료	30,000	허용	노출
150	BET (5point)	비표면적 측정장치	시료	60,000	허용	노출
149	BET (Point 추가)	비표면적 측정장치	포인트	5,000	허용	노출
148	BJH(추가 흡/탈착 40 point)	비표면적 측정장치	시료	120,000	허용	노출
147	BJH (Point 추가)	비표면적 측정장치	포인트	5,000	허용	노출
146	기본사용(UPLC/UV검출기사용)	액체크로마토그래프/질량분석기	시간	36,000	허용	노출
145	기본사용 + MS or ELSD 검출기 사용	액체크로마토그래프/질량분석기	시간	45,000	허용	노출
144	TMA(선열팽창계수)	열기계분석기	시료	50,000	허용	노출
143	비접촉 먼지향 측정기	복합내구성시험기	시료	6,000	허용	노출
142	연필경도계	복합내구성시험기	시료	42,000	허용	노출
141	UTM(챔버사용)	복합내구성시험기	시간	12,000	허용	노출
140	기본사용	롤투롤 멀티코터	Day	600,000	허용	노출

139	기본사용	가스부식시험기	시간	12,000	허용	노출
138	가스비(협의)	가스부식시험기	-	0	허용	노출
137	기본사용	듀얼 이온크로마토그래피	시료	60,000	허용	노출
136	기본측정(스펙트럼)	라만분광기	시료	30,000	허용	노출
135	기본사용(인장강도측정)	만능물성시험기	시료	15,000	허용	노출
134	기본사용 + Extensometer 사용	만능물성시험기	시료	35,000	허용	노출
133	UTM(만능재료시험기)	복합내구성시험기	시료	30,000	허용	노출
132	TMA-Tg, CTE(KOLAS성적서)	열기계분석기	시료	120,000	허용	노출
131	WHCK (Data)	스마트 센서 검사 시스템	회	280,000	허용	노출
130	관찰(기본)	나노분석주사전자현미경	시간	75,000	허용	노출
129	FIB for TEM(3H기준)	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	회	400,000	허용	노출
128	Plasma cleaning(Grid)	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	회	38,000	허용	노출
127	기본측정(STEM)	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	시간	100,000	허용	노출
126	초음파분산	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	회	33,000	허용	노출
125	경도, 탄성계수측정(기본 3포인트)	나노경도/스크래치 테스터	시료	69,000	허용	노출
124	마찰계수, 거칠기 측정	나노경도/스크래치 테스터	시료	72,000	허용	노출
123	경도, 탄성계수측정(포인트추가)	나노경도/스크래치 테스터	포인트	6,000	허용	노출
122	기본사용	TSP 패키징시스템	시간	20,000	허용	노출
121	EDS분석 - Point	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	포인트	15,000	허용	노출
120	EDS분석 - Map	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	포인트	25,000	허용	노출
119	Carbon Grid	전계방출형 주사투과전자현미경 & 집속이온빔 장치	개	18,000	허용	노출
118	Coating system(Os,Pt,C)	나노분석주사전자현미경	회	32,000	허용	노출
117	EDS분석 - Map	나노분석주사전자현미경	포인트	25,000	허용	노출
116	EDS분석 - Point	나노분석주사전자현미경	포인트	15,000	허용	노출
115	FIB for SEM	나노분석주사전자현미경	회	248,000	허용	노출
114	Mounting & Grinding & polishing	나노분석주사전자현미경	시료	84,000	허용	노출
113	Nano workstation	나노분석주사전자현미경	시간	460,000	허용	노출
112	대면적 파티클 검사	나노분석주사전자현미경	회	460,000	허용	노출
111	이온밀링(3시간초과)	나노분석주사전자현미경	회	280,000	허용	노출
110	광학/실체 현미경	고배율 현미경	시간	20,000	허용	노출
109	관찰(기본)	나노분광분석용주사전자현미경	시간	75,000	허용	노출
108	EDS분석 - Point	나노분광분석용주사전자현미경	포인트	15,000	허용	노출
107	EDS분석 - Point	이중분석주사전자현미경	포인트	15,000	허용	노출
106	EDS분석 - Map	이중분석주사전자현미경	포인트	25,000	허용	노출
105	FIB - for SEM	이중분석주사전자현미경	회	248,000	허용	노출
104	이온밀링(3시간초과)	이중분석주사전자현미경	회	280,000	허용	노출
103	Mounting & Grinding & polishing	이중분석주사전자현미경	시료	84,000	허용	노출
102	Tapping/Contact Mode	주사탐침현미경	포인트	65,000	허용	노출
101	롤투롤진공증착	롤투롤진공코팅시스템	Day	600,000	허용	노출
100	진동시험	복합진동내구성시험기	시간	72,000	허용	노출
99	Coating system(Os,Pt,C)	이중분석주사전자현미경	회	32,000	허용	노출
98	관찰(기본)	이중분석주사전자현미경	시간	75,000	허용	노출
97	3D CT	엑스선컴퓨터단층촬영기	시간	270,000	허용	노출
96	EDS분석 - Map	나노분광분석용주사전자현미경	포인트	25,000	허용	노출
95	이온밀링(3시간초과)	나노분광분석용주사전자현미경	시료	280,000	허용	노출
94	Coating system(Os,Pt,C)[SFE]	나노분광분석용주사전자현미경	회	32,000	허용	노출
93	Mounting & Grinding & polishing	나노분광분석용주사전자현미경	시료	84,000	허용	노출

92	FIB - for SEM(SFE)	나노분광분석용주사전자현미경	회	248,000	허용	노출
91	금속피막-피막두께 측정(KOLAS성적서)	나노분광분석용주사전자현미경	회	140,000	허용	노출
90	기본사용	스캐닝음향현미경	시간	72,000	허용	노출
89	2D X-Ray	엑스선컴퓨터단층촬영기	시간	72,000	허용	노출
88	기본 사용	플렉서블터치센서검사기	시료	40,000	허용	노출
87	일광/우천환경시험	모듈구성부품피로시험장비	Day	180,000	허용	노출
86	Haze 측정	자외선/가시광선 분광기	시료	60,000	허용	노출
84	기본사용(흡광도, 투과율, 반사율)	자외선/가시광선 분광기	시료	25,000	허용	노출
83	Circular Dichroism(원색법)	이색편광특성프로파일러	시료	22,000	허용	노출
82	Linear Dichroism(선색법)	이색편광특성프로파일러	시료	32,000	허용	노출
81	Optical Rotation Dichroism	이색편광특성프로파일러	시료	42,000	허용	노출
80	고정반사율(5,45deg)	광특성프로파일러	시료	45,000	허용	노출
79	가변반사율(20~60deg)	광특성프로파일러	시료	48,000	허용	노출
78	기본사용	태양전지 발전량 모니터링 시스템	Day	100,000	허용	노출
77	성적서 및 보고서 발행	항온항습 신뢰성평가 장비	-	10,000	허용	노출
76	신뢰성분석(온도, 습도)	항온항습 신뢰성평가 장비	시간	14,000	허용	노출
75	EL/PL 측정(셀, 모듈 및 웨이퍼)	부품소재비접촉결함시험장비	시료	30,000	허용	노출
74	AEP Simulation	부품소재비접촉결함시험장비	회	110,000	허용	노출
73	산소투과도측정	상대가스투과도측정기	Day	220,000	허용	노출
72	온도 및 습도시험	솔라복합환경시험장비	Day	300,000	허용	노출
71	PID발전성능 및 모듈수명시험	솔라복합환경시험장비	회	4,000,000	허용	노출
70	절연저항시험	태양광 전기특성 평가장비-절연저항시험기	시료	24,000	허용	노출
69	광조사/습윤 복합시험	태양광부품소재가속내구성시험장비	Day	2,200,000	허용	노출
68	습윤환경 시험	태양광부품소재가속내구성시험장비	Day	1,650,000	허용	노출
67	기본사용1(200MHz~1.0GHz영역대 측정)	전자파 차폐 소재 평가 시스템	시료	45,000	허용	노출
66	기본사용 + 시료커팅 및 출제작	전자파 차폐 소재 평가 시스템	시료	55,000	허용	노출
65	기본사용(Solar Simulator - 1kW)	태양전지평가시스템	시료	40,000	허용	노출
64	자동적정(pH별 제타포텐셜)	입도분석기	시료	65,000	허용	노출
63	제타포텐셜 측정	입도분석기	시료	55,000	허용	노출
62	기본(나노수준) + 분산조건	입도분석기	시료	50,000	허용	노출
61	기본(마이크로수준) + 분산조건	입도분석기	시료	50,000	허용	노출
60	마이크로입자(입도,형상) 측정	입도분석기	시료	35,000	허용	노출
59	입자형상분석기	입도분석기	시료	12,000	허용	노출
58	조분쇄기(Jaw Crusher) 사용	건식분쇄기	시간	40,000	허용	노출
57	고압분산기(Nanomizer)	습식초미세분쇄기	시간	30,000	허용	노출
56	Ultrar apex mill(Beads mill)	습식초미세분쇄기	시간	70,000	허용	노출
55	분말 물성측정	건식분쇄기	시료	35,000	허용	노출
54	분무건조(Spray dry)	건식분쇄기	시간	60,000	허용	노출
53	기본사용+파장대역별 광반응 특성 측정 계측 : 20~1000nm(대면적 태양전지 효율)	태양전지평가시스템	시료	100,000	허용	노출
52	대면적 시뮬레이터~1.6kW(대면적 측정 태양전지 효율 및 신뢰성 평가시스템)	태양전지평가시스템	시료	60,000	허용	노출
51	양자효율측정(대면적 태양전지 효율 및 신뢰성 평가시스템)	태양전지평가시스템	포인트	80,000	허용	노출
50	EL-Imaging(전계발광영상시스템)	태양전지평가시스템	시료	95,000	허용	노출
49	면저항 측정(기본)	면저항측정기	시료	30,000	허용	노출
48	기본사용 + Gas/Water permeability	투과도 측정기	시료	50,000	허용	노출
47	기본사용(Pore size 측정)	투과도 측정기	시료	40,000	허용	노출
46	Jet mill 분쇄/분급	건식분쇄기	시간	80,000	허용	노출
45	Ball mill	습식초미세분쇄기	시간	30,000	허용	노출
44	대면적표면굴곡측정	대면적표면굴곡측정기	시료	40,000	허용	노출
43	DSC 기본사용(2시간)	열분석기	시료	34,000	허용	노출
42	Rolling	플렉서블 내구 시험기	Day	70,000	허용	노출
41	Folding	플렉서블 내구 시험기	Day	70,000	허용	노출
40	기본사용(단일물질성장)	분자빔박막성장시스템	회	100,000	허용	노출
39	기본사용(다원계물질성장)+고온공정	분자빔박막성장시스템	회	400,000	허용	노출

38	기본사용(다원계 물질 성장)	분자빔막성장시스템	회	300,000	허용	노출
37	기본사용(단일물질성장)+ 고온공정	분자빔막성장시스템	회	200,000	허용	노출
36	기본사용료(Wet/Dry Scrubber포함)	플라스마식각장비	시료	100,000	허용	노출
35	표면처리	플라스마식각장비	시료	50,000	허용	노출
34	전처리 장비 사용	터치소재 환경분석기	시료	70,000	허용	노출
33	기본사용	터치소재 환경분석기	시료	90,000	허용	노출
32	기본 + 현미경측정(MCT)	적외선흡수분광기	시료	32,000	허용	노출
31	DSC-Tc, Tg, Tm(KOLAS성적서)	열분석기	시료	120,000	허용	노출
30	DSC 비열측정(2시간)	열분석기	시료	38,000	허용	노출
29	TGA 기본사용(2시간)	열분석기	시료	30,000	허용	노출
28	시간 추가(1시간)	열분석기	시간	10,000	허용	노출
27	유리표면응력 측정	유리표면응력계	시료	18,000	허용	노출
26	유전율 측정	유리표면응력계	시료	18,000	허용	노출
25	기본사용(시료전처리불필요/ATR)	적외선흡수분광기	시료	20,000	허용	노출
24	기본 + 분말시료 펠렛제작	적외선흡수분광기	시료	30,000	허용	노출
23	기본사용	스퍼터링 증착 시스템	Day	180,000	허용	노출
22	기본사용+고온공정	스퍼터링 증착 시스템	Day	270,000	허용	노출
21	Photo-lithography(다목적측정현미경, WetStation 포함)	사진식각공정시스템	시간	100,000	허용	노출
20	성적서 및 보고서 발행	그라비아 오프셋 프린팅 장비	-	10,000	허용	노출
19	박막 두께측정(3Point)	나노박막두께측정기	시료	12,000	허용	노출
18	기본사용(프린팅)	나노소재잉크평가장비	Day	70,000	허용	노출
17	성적서 및 보고서 발행	나노소재잉크평가장비	-	10,000	허용	노출
16	박막두께측정	내열내구성검사기	시료	100,000	허용	노출
15	광학정수 측정(굴절률, 흡수계수)	내열내구성검사기	포인트	50,000	허용	노출
14	항온항습기	내환경신뢰성장비	Day	160,000	허용	노출
13	열충격시험기	내환경신뢰성장비	Day	200,000	허용	노출
12	기본사용(프린팅)	그라비아 오프셋 프린팅 장비	시간	42,000	허용	노출
11	기본사용(샘플사이즈-100x100mm)	고차단투습도측정기 2 (Model 3)	Day	250,000	허용	노출
10	기본사용(샘플사이즈-80x80mm)	고차단투습도측정기 1 (Model 1)	Day	220,000	허용	노출
9	스핀코터 사용	사진식각공정시스템	시료	10,000	허용	노출
8	기본사용(증착)	열증착시스템 & Glove box	시간	100,000	허용	노출
7	발전성능검사시험	PID성능검사장비	시료	50,000	허용	노출
6	기본사용(분말또는박막상분석) + 결과해석(X-pert highscore plus 사용)	X선회절분광기	시료	55,000	허용	노출
5	XRR	X선회절분광기	시료	55,000	허용	노출
4	In-situ 고온 상분석	X선회절분광기	시간	200,000	허용	노출
3	정성 및 정량분석	고분해능 글로우방전 질량분석기	시료	800,000	허용	노출
2	Depth Profiling	고분해능 글로우방전 질량분석기	시료	165,000	허용	노출
1	염수분무시스템	내환경신뢰성장비	Day	240,000	허용	노출